งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเคลือบฟิล์มบางของไททาเนียมไคออกไซค์บนผิวของสเตนเลส สตีล เกรค 316L ด้วยเครื่องอันบาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอร์ โดยใช้เป้าสารเคลือบเป็นไททาเนียมบริสุทธิ์ ร้อยละ 99.999 ระยะระหว่างเป้าสารเคลือบกับชิ้นงานสเตนเลสเท่ากับ 6.5 เซนติเมตร ควบคุมความ คันรวมในระบบเท่ากับ 5.0x10⁻³ มิลลิบาร์ และเปลี่ยนแปลงค่าอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอนต่อ ออกซิเจนเป็น 1.0/2.0, 1.0/3.0, 1.0/4.0 และ 0.5/4.0 sccm โดยเวลาที่ใช้ในการเคลือบแต่ละครั้งคือ 90 นาที ฟิล์มที่เคลือบแล้วจะถูกนำไปปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน (thermal treatment)ในเตาเผา ใฟฟ้าที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส โคยมีอัตราการให้ความร้อน 5 องศาเซลเซียสต่อนาที หรือนำไป ปรับปรุงคุณสมบัติด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซก์ (NaOH) ความเข้มข้น 10 M (alkali treatment) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวและ ปรับปรุงคุณสมบัติจุ่มลงในสารละลาย SBF โคยควบคุมอุณหภูมิคงที่ที่ 37 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 7 วัน เพื่อศึกษาการเกิดสารประกอบไฮดรอกซือปาไทท์ โดยชิ้นงานทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์ คุณสมบัติ ทางกายภาพ และองค์ประกอบทางเคมีค้วย SEM, EDX, AFM และ XRD จากผลการทคลองพบว่า ฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซก์ที่สังเคราะห์ได้ในทุกก่าอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจน เป็นฟิล์มไททาเนียมไคออกไซค์ที่มีเฟสเป็นรูไทท์ (Rutile) มีความหนาในช่วง 90-140 nm เมื่อนำฟิล์ม บางไททาเนียมไดออกไซค์ที่สังเคราะห์ได้ไปผ่านกระบวนการ thermal treatment จะพบว่าฟิล์มบาง ไททาเนียมไดออกไซค์จะมีโครงสร้างที่เป็นผลึกเพิ่มขึ้น และไม่เกิดการแตกบนผิวฟิล์ม แต่เมื่อนำ ฟิล์มไปผ่านกระบวนการ alkali treatment จะพบว่าฟิล์มมีโครงสร้างเป็นแบบอสัณฐาน (amorphous) และเกิดการแตกบนผิวของฟิล์ม ในทุกอัตราการไหลของแก๊สอาร์กอนต่อออกซิเจนที่ใช้สังเคราะห์ ฟิล์ม นอกจากนี้ เมื่อแช่ชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบผิวและปรับปรุงคุณสมบัติลงในสารละลาย SBF พบว่า ชิ้นงานที่ไม่ถูกปรับปรุงผิว (non-treatment) จะมีการเกิดสารประกอบไฮครอกซือปาไทท์ได้ หนาแน่นมากที่สุด และชิ้นงานผ่านกระบวนการ thermal treatment จะเกิดสารประกอบ ไฮครอกซือปาไทท์ได้เบาบางที่สุด ส่วนชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการ alkali treatment จะเกิด สารประกอบไฮครอกซื้อปาไทท์ที่มีความหนาแน่นได้คล้ายคลึงกับชิ้นงานที่ไม่ผ่านกระบวนการ treatment แต่ฟิล์มที่ผ่านกระบวนการ alkali treatment บางส่วนจะถูกละลาย ดังนั้นฟิล์มที่ไม่ผ่าน กระบวนการ treatment จึงมีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับการนำไปใช้ในร่างกาย

TiO₂ thin films deposited on stainless steel 316L substrates were prepared by a DC unbalance magnetron sputtering from a metallic titanium target (purity 99.99%). The target-to-substrate distance was adjusted to 6.5 cm. and a total pressure of 5.0x10⁻³ mbar was controlled. Working gases were Argon and Oxygen whose flow rates were varied from 0.5 to 1.0 sccm and from 2.0 to 4.0 sccm, respectively. The deposition time was 90 min. After deposition, The TiO2 thin films were treated by the ether thermal or alkali treatment. Upon the thermal treatment, coated samples were heated to 600°C with a heating rate of 5°C/min in an electric furnace. For the alkali treatment, coated samples were treated with a 10M NaOH at 60°C for 24 h. All treated samples were soaked in 30 ml of a simulated body fluid (SBF) at 37°C for 7 days for demonstration of the bonelike apatite on the TiO₂ films. The hydroxyapatite formation as well as the structure and morphology of the TiO2 films were investigated by a scanning electron microscopy (SEM), an energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and an X-ray diffraction (XRD) to compare the formation of apatite on the pre-treated TiO₂ films. For all deposition conditions, TiO₂ thin films of rutile phase were deposited on the 316L stainless steel by a DC unbalance magnetron sputtering. All films were smooth without crack with the thickness of about 90-140 nm. After thermal treatment, higher crystalline films could be obtained, as compared with the non-treated films. In contrast, Alkali treated films decreased their crystallinity, probably due to the formation of amorphous sodium titanate and crack. All of samples could induce the formation of hydroxyapatite on their surface after soaking in SBF for 7 days. However more uniform hydroxyapatite films could be observed only on the non-treated films for all coating condition.